

كلية العلوم

القسم : الفيزياء

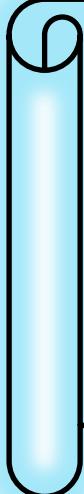
السنة : الرابعة



٩

المادة : علم النانو

المحاضرة : السادسة/نظري/



{{{ A to Z مكتبة }}}}

مكتبة A to Z Facebook Group

كلية العلوم ، كلية الصيدلة ، الهندسة التقنية ، تكنولوجيا المعلومات والاتصالات

يمكنكم طلب المحاضرات برسالة نصية (SMS) أو عبر (What's app-Telegram) على الرقم 0931497960



3-7.5 طريقة الإنماء المباشرة لأنابيب أحادية الجدار Directed Growth of Single-Walled Nanotubes

يمكن إنشاء تركيب أنابيب نانوية أحادية الجدار منتظمة مباشرةً عبر ترسيب أبخرة الميتان الكيميائية على ركائز منمطة تحفيزياً. **لدرس**، على سبيل المثال، طريقة تطورت لإنماء شبكات أنابيب نانوية معلقة على ركائز تحوي دعامات سيلكونية تم تتميّتها بطريقة الطباعة الحجرية:

- يبدأ النمو بتحضير مادة تحفيز سالفة في طورها السائل مسبقاً تتفوق في مزاياها على محفّزات الحالة الصلبة من خلال سماحها بتشكل طبقات تحفيز متجانسة Uniform من أجل تتميّط محفّزٍ كبير المدى على السطوح.
- تتألف المادة السالفة من

→ بوليمر مشترك **ثلاثي وحدة** البناء Tri-block Copolymer

→ وكلوريدات الألمنيوم وكلوريدات الحديد وكلوريدات المولبدينيوم

→ تقع في خليطٍ من مذيبات الإيثانول (كحول إيثيلي) Ethanol والبوتانول Butanol (كحول رباعي الكربون):

✓ يُوفّر **كلوريد الألمنيوم** إطار أكسدة عند **تأكسده** بالحملة (بالتحليل بالماء) أو التكليس بالإحماء (عملية تحميص في ظروف مؤكسدة) في الهواء.

إذ يوجّه البوليمر الثلاثي المشترك تركيب إطار الأكسدة **ويؤدي** إلى تشكّل بنية تحفيز مسامية بعيد التكليس بالإحماء.

✓ كما يمكن **كلوريد الحديد** أن يشكّل جسيمات تحفيز ضرورية من أجل إنشاء الأنابيب النانوية.

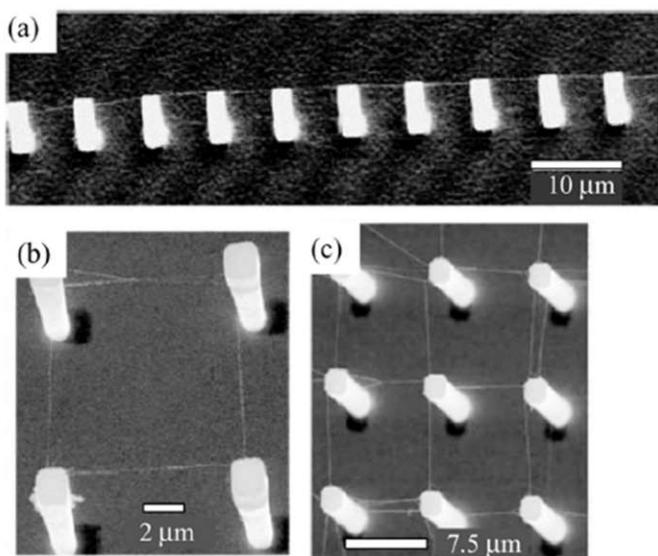
→ إذ **تشكل** في البداية مادة التحفيز - السالف في **فلم ريق** على قالب من سيلوكسان- ثانوي الميثيل المتعدد Polydimethyl Siloxane Stamp

→ يلي ذلك طبعة تماضية Contact Printing لنقل السالف المحفّز **انتقائياً** على الأجزاء العلوية لدعامات Pillar Tops مصنّعة- مسبقاً على ركيزة سيلكونية.

→ ثم **تكلس** الركيزة المطبوعة **بالإحماء** ثم **تُستعمل** في عملية الإنماء بطريقة ترسيب الأبخرة الكيميائية.

يجدر بالذكر أن الأنابيب النانوية المتمامية **على الأجزاء العلوية للدعامات** تسعى لأن تتجه من دعامة إلى أخرى. يظهر في **الشكل (5-27)** نمو موجّه لأنابيب نانوية أحادية الجدار - معلقة من أجل ثلاثة تشكيلات مختلفة للدعامات:

- I.** أنابيب نانوية موزعة على هيئة حبلٍ شبّه بحبل مصابيح الزينة الكهربائية؛
- II.** أنابيب نانوية مربعة التوزّع؛
- III.** شبكة مكثفة من الأنابيب النانوية المعلقة.



الشكل (5-27): رؤوس دعامات متراوطة بأنابيب كربون نانوية أحادية الجدار معلقة، تشكّل

- (a) تركيباً من الأنابيب النانوية شبّهها بحبل مصابيح الكهرباء؛
- (b) مربعاً من الأنابيب النانوية؛
- (c) شبكة مكثفة من الأنابيب النانوية المعلقة.

- **تُنَوّى** أنابيب نانوية على **رؤوس الدعامات** فقط طالما أن طريقة الطبع المحفّز لا تضع أي مواد تحفيز أسفل الركيزة.

- **وأثناء النمو الطولي** للأنابيب

- النانوية **✓** يحافظ تدفق الميثان على جعل الأنابيب النانوية **عائمةً** و"متّوجة" لأن سرعة التدفق بالقرب من قعر السطح **أخفض** بكثير

من سرعة التدفق عند مستوى "رؤوس الدعامات".

✓ وهذا بدوره **يمنع ققص** الأنابيب النانوية عند أسفل السطح.

✓ ومن جهة أخرى، توفر الدعامات المجاورة نقاط تثبيت للأنابيب المتمامية؛

✓ فإذا مسّ أنبوب متّوج دعامة مجاورة، فإن تآثرات فاندرفالس بين الأنبوب والدعامة ستؤسر الأنبوب النانوي **وتحافظ** عليه عالياً (أي معلقاً في الجو).

✓ ووفق نمط النمو هذا يمكن تصنيع أنابيب نانوية معلقة بأطوال جهريّة؛ إذ يمكن إنشاء أنابيب بأطوال تزيد عن 150 μm.

4-7-5 إنشاء أنابيب نانوية معزولة على موقع سطحي خاص

Growth of Isolated Nanotubes on a Specific Surface Site

من المهم الإشارة إلى أن طريقة ترسيب الأبخرة الكيميائية تسمح بإنماء أنابيب نانوية مفردة في مواقع خاصة على ركائز كوارتزية SiO_2 مستوية حيث تشمل ترسيب أبخرة كيميائية من الميثان على ركائز تحوي جزر محفزة متسبة بطريقة الطباعة الحجرية بحزمة إلكترونية. إذ تم الحصول بهذه الطريقة على نبات ذا ذات أنابيب نانوية معزولة ثمينة من الجزر. تؤدي طريقة الإنماء هذه وبسهولة إلى تحضير أنابيب تكون وتنظم من موقع سطحية مضبوطة جيداً فضلاً عن تمكيننا من تطوير طريقة مضبوطة لتكامل الأنابيب النانوية في تراكيب قابلة التوجيه Addressable Structures.

5-8 الطائق الكيميائية والحيوية المستخدمة في التصنيع على المستوى النانوي:

Chemical and Biological Methods for Nanoscale Fabrication

تعتمد التكنولوجيات المدرسية في الفرات السابقة في المقام الأول على عمليات وطراائق فизيائية.

ثم إنَّ استخدام الطرائق الكيميائية والحيوية يفتح أساليب جديدة أمام التصنيع على مستوى النانومتر. من الواضح أنَّ بمقدور "النسج الكيميائي" Chemical Synthesis إنتاج جسيمات نانوية متنوعة جداً، بما فيها الجمل النانوية اللاعضوية، والعضوية، والحيوية. أضف إلى ذلك، يمكن أن تكون الكيمياء والحيوية مكمليَّن لطرائق التصنيع النانوي الفيزيائي المتوفّرة والمعمول بها. وعلى وجه الخصوص، تقدِّم تقنيات الكيمياء والحيوية المُختارة بدائل للطباعة الفوتونية التقليدية. تستند إحدى هذه الطرائق إلى ظاهرة التجمُّع الذاتي Self-Assembly، إذ من المعلوم أنه توجد جزيئات تسعى بفضل العمليات الفيزيائية، أو الحيوية، أو الكيميائية لأنَّ تحتشد في تراكيب دورية على المدى الطويل.

- **تُسْهِلُ هَذِهِ التَّرَاكِيبُ** تَصْنِيعَ أَقْنَعَةٍ دُورِيَّةٍ مُنْظَمَةٍ عَلَى سُطُوحٍ مُصْنَوِّعٍ مِنْ فَلِزٍ أَوْ نَصْفٍ نَاقِلٍ
 - بِدُورٍ مُمِيزٍ يُسَاوِي مِنْ 10 nm ← 50 nm
 - وَبِسَمَامَاتٍ دَاخِلِيَّةٍ تَبْلُغُ أَقْطَارَهَا مِنْ 5 nm ← 25 nm.
 - تَتَفُوقُ مِثْلُ هَذِهِ الْمَقْدِرَةِ الْفَاصِلَةِ عَلَى الْمَقْدِرَةِ الْفَاصِلَةِ لِلْطَّبَاعَةِ الْفُوْتُونِيَّةِ الْتَّقْليِدِيَّةِ وَالَّتِي تَبْلُغُ فِي الْوَقْتِ الْرَّاهِنِ نَحْوَ 100 nm.
 - أَضْفَ إِلَى ذَلِكَ، فَرَضَتْ طَرِيقَةُ التَّجْمُعِ الذَّاتِيِّ نَفْسَهَا عَلَى تَقْنِيَاتِ الطَّبَاعَةِ الْحَجَرِيَّةِ بِحَزْمَةِ الْإِلْكْتُرُوْنِيَّةِ، وَالْمُسْتَخْدَمَةِ فِي الْوَقْتِ الْرَّاهِنِ مِنْ أَجْلِ طَبَاعَةِ مِثْلِ هَذِهِ التَّرَاكِيبِ الصَّغِيرَةِ، مِنْ خَلَالِ تِكَافِهَا الْأَقْلَى بِكَثْرَةِ وَزْمَانِ الْاِنْهَازِ الْأَقْصَرِ.

يمكن تطبيق الطرائق الكيميائية "النسج" المركب الكيميائي والبنية الكيميائية على سطح من خلاٍ استعمال أداة كتابة مباشرة تكمن في طباعة نانوية جديدة بقلم مغموس Dip-Pen حيث تولد عملاً كيميائياً متسبقاً مسطح الشكل يطول يبلغ من 1 nm ← 100 nm.

وبدورها ولدت النجاحات في علم الحيوية طرائق جديدة لتحضير مواد نانوية التركيب بخصائص محددة مسبقاً وقابلة للبرمجة من أجل وحدات بناء لاعضوية.

التجمُّع الذاتي الكيميائي لتركيب على المستوى النانوي

Chemical Self-Assembly of Nanoscale Structures

ندرس هنا جملة كيميائيةً قوامها **بوليميرات بناء تساهمية** *Block Copolymers*. تُبدي هذه الجملة انتظاماً ذاتياً يمكن استخدامه من أجل التمثيل النانوي *Nanopatterning*.

تعريف البولимер التساهمي البناء:

هو جزيء كبير (جهي) *Macromolecule* يتتألف من عدة وحدات بلمرة *Polymer Blocks* يمكنها عادةً أن تتمو بعدة خطوات، والشكل (5-28) يوضح مثلاً على **بلمرة ثلاثة** وحدة البناء:

→ يبدأ نسج هذا الجزيء الكبير **بتبلمر** مونومير الستايرين (هيدروكربون) *Styrene Monomer*؛ حيث تكون كمية المونومير المقدمة من أجل **الخطوة الأولى** - فقط - كافية لخلق سلسلة **ستايرين مُتممة** *Miniature Styrene Chain* (وهي وحدة البناء الأولى *First Block*) بدرجة تبلمر وسطية تساوي **9**.

(تنويه: تمثل درجة البلمرة عدد الوحدات المونوميرية في جزيء كبير أو في وحدة بناء *Block*).

→ تتمو وحدة بناء ثانية في **الخطوة الثانية** بدرجة تبلمر وسطية مشابهة عند إضافة أيزوبرين كيميائي *Chemical Isoprene* آخر (هيدروكربون سائل ملتهب).

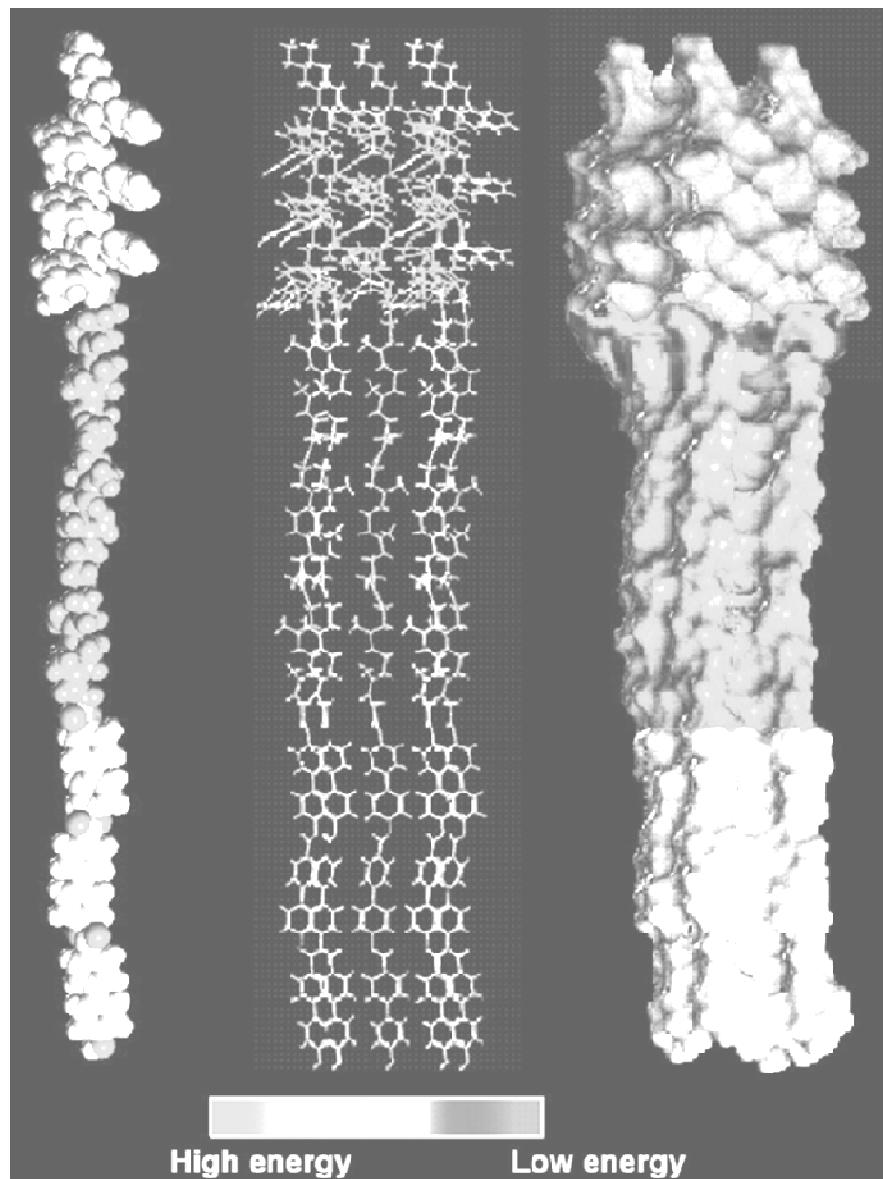
→ وفي **الخطوة الثالثة**، يُقحم ثالثي أكسيد كربون (CO_2) في مجموعة كربوكسيلية طرفية **عند قمة البوليميرات التساهمية** ثالثية الوحدة السابقة المُتممة *Carboxyl End Groups*.

► إن الطرف السفلي للوحدة الثلاثية كاره للماء *Hydrophobic*

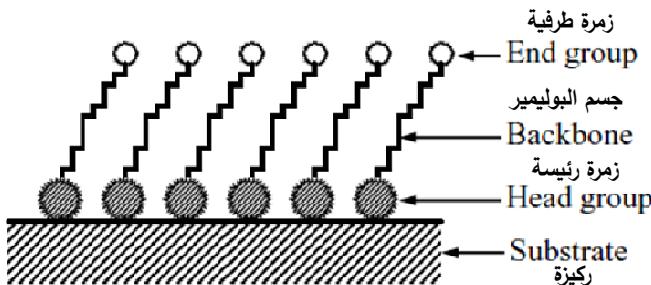
► في حين إن الطرف المقابل العلوي محب للماء *Hydrophilic* أي ماضٌ له.

→ تأخذ هذه الجزيئات ثلاثة وحدة بناء شكل قضيب - وشيعة *Rod-Coil* ذو مقطع قاسي شبيه بالقضيب المُحجزن *Stiff Rod-like Segment* (الوحدة الثانية) متصلٌ تكافؤياً بمقاطع التوائية أكثر مرنة.

→ وعادةً تؤدي العمليات الكيميائية إلى تشتت - متعدد *Polydispersity* للجزيئات الثلاثية الناتجة ولكن هذه التشتتية تكون صغيرة هنا. إذ تأرجح نسبة الكتل الجزيئية المتوسطة - كتالياً إلى الكتل الجزيئية المتوسطة - عددياً بين القيمتين (1.06) و (1.1).



الشكل (28-5): رسم لجزيء التجمع الذائي ثلاثي وحدة البناء (اليسار) ولعنقود مكون من جزيئات جهيرية ثلاثية وحدة البناء (في الوسط واليمين) ورسم لشفرة مظللة للطاقة في قطاعات مختلفة من العنقود (في أسفل الصورة).



الشكل (29-5): تمثيل تخطيطي لfilm بوليمر ثلاثي وحدة البناء؛ يظهر البوليمر "واقفاً".

بدرجة عالية من الانتظام الذاتي، كما يوضح تخطيطياً **الشكل (29-5)**.

→ يمتلك **film** بوليمر ثلاثي الوحدة بنية "واقفة" Standing-up نموذجية؛

○ إذ تشير الدائرة المظللة إلى زمرة رئيسة Head-group ماصة- كيميائية

○ والدائرة المفتوحة تشير إلى زمرة طرفية End-group يمكن اختيارها من مجموعة واسعة من المركبات الكيميائية معينة الوظيفة.

يظهر في **الشكل (30-5)** مظهراً علويّاً لfilm حقيقى تم الحصول عليه بوساطة المجهر الإلكتروني بالنفوذ:

■ فالمقاطع القاسية الشبيهة- بالقضبان للوحدات ثلاثية البناء هي التي تدفع بالانتظام الواضح للجزيئات الكبيرة في **film**.

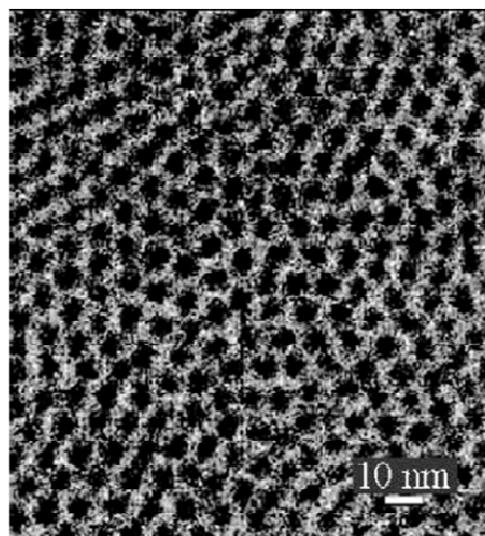
■ وعلى وجه الخصوص، ثمة **توازن** بين قوى التجاذب والتنافر **بحكم** تشكّل **الخلايا** **الجزيئية** **الكبيرة**

على **Macromolecular Cells**

يحصل في البلورة.

■ وفي العموم، **تُغطّي** **البوليمرات** التساهمية ثلاثية وحدة البناء سطوح بلورات الفلزات وأنصاف النوافل المختلفة بسهولةٍ و**تُشكّل** تراكيب دورية ثنائية البعد بتناظرات مختلفة تتارجح بين التناظر المنخفض والترانزير المربعية والمسدسة.

■ وتمتلك **أفلام** **البلمرة** **المصنعة** **سمكّات** تتارجح بين عشرات ومتات **النانومترات** وتوجد فيها **مسامات** **بأبعاد** **مختلفة** وأشكال مختلفة أيضاً.



الشكل (30-5): صورة مجهرية تم التقاطها ب TEM لfilm تشكّل **الجزيئات** **ثلاثية** **وحدة** **البناء**، حيث تُظهر هذه الصورة توزعاً منتظماً **شكلاً** **ووجماً** **تشكل** **ذاتياً** في **قطاعات** **فائقة** **الشبكة** **البلورية**.

توجد طريقتان لخلق تراكيب نانوية تستخدمان التجمع الذاتي لبوليميرات البناء:

- I. ترسيب بلورات فلزية أو بلورات لاعضوية على قناع بلمرة متصل بركيزة.
- II. استخدام قناع البلمرة من أجل المعالجة المتتالية للركيزة أو استعماله كداعم لإضافة أقنعة أخرى اختيارية.

- بعد تشكّل القناع على سطح مصنوع من مادة نصف ناقلة تبقى تقنية تصنيع النبائط ذاتها كما في الصناعة النانوية التقليدية حيث تستعمل
 - أيونات جافة، أو تتميّز انتقائي،
 - أو أكسدة، أو معدنة،
 - أو انتشار، أو إنماء انتقائي، الخ.

الطباعة الحجرية النانوية بالقلم المغموس :Dip-Pen Nanolithography

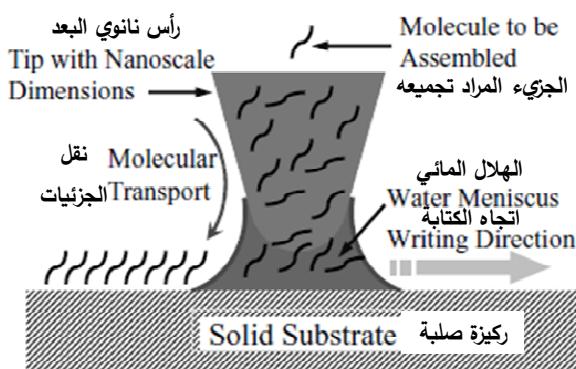
- منذ ابتكار المجهر النفقي الماسح STM والتقنيات المشابهة ظهرت مساعي لتطوير طرائق طباعة حجرية نانوية جديدة، وقد طُبّقت على وجه الخصوص طرائق قوامها STM و AFM من أجل:
- أكسدة تراكيب نانوية،
 - أو كشطها (سجها)،
 - أو تتميّزها على أسطح مادية.

ولكن الطرائق المقترنة اقتصرت، بشكل عام، على **إنماء أكاسيد رقيقة على أسطح فلزية ونصف ناقلة** أو لمرحلة إجراءات تتميّز لا يمكن تعميمها على التمثيل المتوازي المنتج للتراكيب النانوية.

وأخيراً، تم تقديم **الطباعة الحجرية بالقلم المغموس (DPN)** (Dip-Pen Nanolithography) بمثابة:

- رسم هندسي يُستخدم مساحاً للكتابة المباشرة يُستعمل فيه رأس مجهر القوة الذرية AFM

إطلاق كواشف كيميائية



الشكل (41-5): عنصر "الكتابة" الرئيسي لجملة مطبوعة ضوئياً بقلم مغموس؛ عنصر "الكتابة" هذا نانوي التركيب ومؤلف من رأس نانويي البعد؛ تُرسّب السوائل المتقدمة على سطح الرأس على سطح ركيزة في منطقة يتشكّل فيها هلال بين الرأس والسطح

بشكل Chemical Reagents مباشر على مناطق نانوية البعد للركيزة الهدف، كما يوضح **الشكل** (41-5).

▪ وتقنيّة الطباعة الحجرية النانوية بالقلم المغموس DPN هي نوع من الرسم الهندسي المادي الناعم حيث تُعزى كلمة "ناعم" إلى

المركب الكيميائي للتراكيب النانوية التي يمكن تصنيعها.

تصنُع التراكيب النانوية من **ريبيطات عضوية** (ذرة أو مجموعة ذرات أو أيونات تُحيط بالذرة المركزية) بدلاً من مواد في طورها الصلب. Organic Ligands

وعلى الرغم من أنّ ثمة احتمالاً ضعيفاً أن تحل تكنولوجيات DPN مكان طرائق التصنيع التقليدية في الطور الصلب إلا أنها مكملة لها. وهناك الكثير من المسائل العلمية الممتعة والعملية المهمة المناسبة للنمذج المصغرة جداً (النمنمة) التي يمكن **التجهيز** إليها نتيجةً لامتلاكها **طرائق الطباعة الحجرية الناعمة** المذكورة أعلاه، والتي بوساطتها يمكن **تنميط الجزيئات** في قالب مضبوط على تريليج طول ما دون المائة 100 nm.

فمثلاً، يمكن لطريقة رسم كهذه أن تولّد تراكيب ناقلة جزيئية القوام على المستوى النانوي وتؤمن تلامسها مع مساري جهوية **التجهيز** - مُحضرّة بطرائق تصنيع دقيقة تقليدية.

إن فكرة الطباعة الحجرية النانوية - المبتكرة بالقلم المغموس DPN هي فكرة تكنولوجيا النمنمة التي تعود إلى 400 سنة والتي تُعرف بتكنولوجيا القلم الريشة Quill-Pen أو القلم المغموس Dip-Pen.

▪ **دراسة أساسيات DPN** ستدّرك في البداية أن الفكرة البسيطة المتمثلة في نقل أي "جبر Ink" باستعمال رأس AFM نانوي - إلى سطح استناداً إلى فعل الظاهرة الشعرية المعروفة جيداً لا تعمل بدقة هنا؛

▪ وبدلاً من ذلك، فإن الفكرة الأساسية تكمن في تصميم منظومة مزودة بجبر بمقدورها التفاعل مع الركيزة المستهدفة كيميائياً.

يوضح **الشكل** (41-5) تمثيلاً للعناصر الرئيسية للرسم النانوي - DPN:

- **رأس AFM متحرك** مغطى بجزيئات الجبر المراد نقلها،
- **وسط مائي** هاللي الشكل Water Meniscus يتشكل بين الرأس والركيزة الصلبة،
- **جزيئات** جبر تتفاعل مع الركيزة.

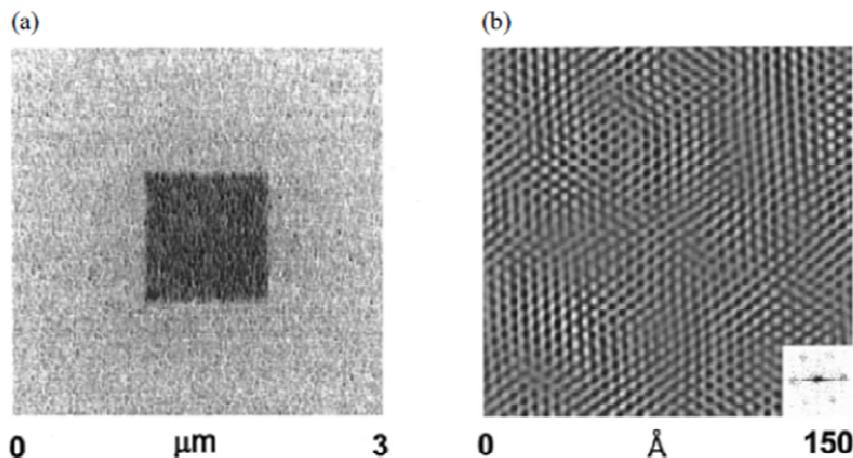
▪ يسمى مفعول مثل هذا التفاعل الكيميائي مع السطح امترزاً كيميائياً Chemisorption.

▪ ويفعل مثل هذا الامترز الكيميائي فعل قوة دفع لنقل الجزيئات من الرأس إلى الركيزة فتشكل على أثر ذلك تراكيب نانوية مستقرة **بسماكمة جزيء واحد**.

▪ والأساس اللازم لجعل هذه الطريقة ناجحة **يكمّن في انتقاء جزيئات عضوية** بإمكانيات إذابة منخفضة في الماء بحيث تُسهل قوة دفع الامترز الكيميائي ضبط خصائص الانتقال من الرأس إلى الركيزة.

▪ وهذا ما يمنع الامتصاص والترانكيمائي غير المضبوط وغير المخصص لطبقات متعددة من الجزيئات على السطح.

يوضح **الشكل** (42-5) نتائج الامترز الكيميائي:



الشكل (42-5): (a) الرسم بالأوكتاديكان على الذهب بوساطة الـ DPN؛ (b) صورة تركيب نانوي في إطار ثابت الشبكة البلورية من الأوكتاديكان ترسب على بلورة وحيدة.

✓ إذ تُظهر الصورة اليسارية غشاء Coating- طلاء "لکحول سلفيد الأوكتاديكان على سطح من الذهب بمساحة $1 \mu\text{m}^2$ باستعمال DPN.

(الأوكتاديكان $\text{C}_{18}\text{H}_{38}$ مركب من كربوهيدريت الألكان صيغته الكيميائية $(\text{CH}_3(\text{CH}_2)_{16}\text{CH}_3)$)

✓ تم التحقق من تشكّل بنية بسماكة طبقة جزيئية واحدة من خلال صورة الشبكة البلورية الأكثر تفصيلاً لمحلول سلفيد- الأوكتاديكان المنقول، كما يظهر في الصورة اليمينية من الشكل (42-5).

✓ فالشبكة البلورية المرصودة سدايسية التبلور بتباعد جزيئي يساوي 5 \AA وهو ثابت الشبكة المعروفة من أجل طبقة أحادية Monolayer من سلفيد- الأوكتاديكان على ذهب تشكّل بعدد من الطرائق الأخرى.

يوضح الشكل (43-5) تطبيقاً للطريقة المذكورة أعلاه حيث:

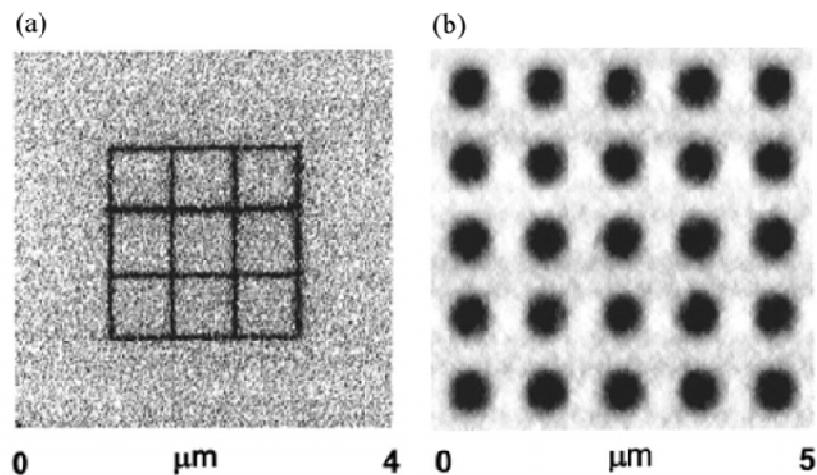
► تُظهر الصورة في اليسار شبكة متصالبة جزيئية Molecular Grid من سلفيد- الأوكتاديكان على الذهب؛

► فالشبكة المتصالبة تبدو بسماكة جزيء منفرد وبخطوط عريضة تبلغ 100 nm .

► أما الصورة الواقعة على يمين الشكل (43-5) فتوضح صفيحةً من نقاط Dots توضّعت بانتظامٍ حيث بلغ قطر الواحدة منها 450 nm .

► وتجدر الإشارة إلى أن بلوغ هذا النوع من الانتظام والتكرارية الشكلية غير ممكن بقلم عادي حتى بأبعاد جهريّة.

حالياً، تولّد الكتابة بطريقة الطباعة الحجرية بالقلم المغموس DPN بنيةً نانويةً بخطوطٍ يبلغ عرضها نحو 5 nm (60-70 nm). إن أصغر التراكيب المصنّعة هي نقاط يبلغ قطر الواحدة منها 5 nm والتبعاد فيما بينها 15 nm :



الشكل (43-5): شبكة نانوية البعد (اليسار) ومصفوفة نقط (اليمين) تولدت بوساطة DPN

الجدول (2-5) أمثلة على تراكيب لأحبار وسطوح كيميائية أُسْتَعْمِلُتُ فِي الـ DPN

الاسم الحبر	اسم الركيزة	ملاحظات
الألكيثيلوils	Au	المقدرة الفاصلة 15nm على سطوح أحادية التبلور وأقل أو تساوي 50nm على سطوح متعددة التبلور
Ferrocenylthiols	Au	تركيب نانوية فعالة الأكسدة والإرجاع
Silazanes	SiO_x GaAs	زخرفة على الأكسيد
بروتينات	Au, SiO_x	الكتابة المباشرة والتجميع غير المباشر
بوليميرات مترافقه	SiO_x	ترسيب بوليمير تم التحقق منه طيفياً وكهروكيميائياً
DNA	Au, SiO_x	حساسة للرطوبة وللظروف سيلنة رأس القلم
صبغات متقلورة	SiO_x	أنماط تألق ضوئي
أملاح معدنية	Si, Ge	ترسيب كهروكيميائي وكهرتحليالي
جسيمات غروية	SiO_x	محلول لزج ينبع من رأس القلم

→ لقد تطّور DPN في تمييز مختلف التراكيب حبر - ركيزة.

→ فضلاً عن أن الطريقة متناغمة ومتناهية مع العديد من الأحبار؛ بدءاً من

→ **الجزيئات العضوية الصغيرة**

→ **فالبلميرات الحيوية والجسيمات الغروانية Colloidal Particles**

→ **وصولاً إلى الأيونات والأملاح المعدنية؛**

→ **والأسطح المنَّطة هي**

→ **فلزات،**

→ **وعوازل،**

→ **وأنصاف نوافل.**

→ يشمل **الجدول** (2-5) أمثلة على تراكيب لأخبار وسطوح كيميائية.

وفي الختام، نُشير إلى أنه يمكن تطبيق الطائق الكيميائية والحيوية من أجل تصنيع منظومات نانوية الأبعاد. والجدير بالذكر أن هذه الطائق الجديدة يمكن أن تُكمل التكنولوجيات النانوية نصف الناقلة العادية.

9-5 تصنيع المنظومات الكهروميكانيكية النانوية :Fabrication of Nanoelectromechanical Systems

لقد درسنا في الفقرة السابقة **فن تكنولوجيات أنساف النوافل** التي يمكن استخدامها في إنتاج تراكيب ونبائط نانوية الأبعاد من أجل الإلكترونيات. تُعد التراكيب عالية النوعية ضروريةً من أجل الحصول على خصائص إلكترونية فائقة؛ **فالإنجازات والقدم الكبير** التي حصلت في الإلكترونيات بفضل **هذه التكنولوجيات** يمكن استخدامها من أجل استكشاف نباتات نانوية أخرى شائع تسميتها **منظومات كهروميكانيكية نانوية** (NEMSS).

تشمل هذه الفئة من النباتات:

→ آلات نانوية،

→ ومحسّنات جديدة،

→ وأنواعاً من النباتات الجديدة التي توظّف لتعمل على المستوى النانوي.

تُعد النباتات الميكانيكية النانوية واعدة في أن تُحدث تغييراً أساسياً في قياسات الانزياحات الفائقة الصغر والقوى الضعيفة للغاية، لاسيما على المستوى الجزيئي.

في الواقع، يمكن الآن بوساطة تقنيات المكنته النانوية **الحجمية والسطحية** بناء NEMSS بكتلٍ تقترب من بضعة آتونغرامات ($1 \text{ attogram} = 10^{-18} \text{ gr}$) ومقاطع عرضية **تبلغ** نحو 10 nm .

إن الكتل والأبعاد الصغيرة لـ NEMSS يمنحها عدداً من المزايا الفريدة من نوعها يمكن **استخدامها** من أجل تطبيقات جديدة وقياسات أساسية **كثيرة**. عموماً، من المرجح أن تكون التطبيقات المحتملة لـ NEMSS هائلة ومفيدة في مجالات عديدة ومتعددة؛ بدءاً من مجال الإلكترونيات النانوية وانتهاءً ب المجال الحيوي مروراً بال المجال الطبيعي.

سندرس في هذه الفقرة المفاهيم الأساسية لـ NEMSS، وتكنولوجيا تصنيع الـ NEMSS، والتحديات التي تنشأ في هذا المجال.

يمكن عدّ نبيطة كهروميكانيكية ما على أنها **محول Transducer** ثانوي أو ثلاثي الطرف، أو بشكل عام، متعدد الأطراف بمقدوره أن:

• **يؤمن محفّزات دخلي Input Stimuli** (إشارات قوة Signal Forces كهربائية)

• ويقرأ، بمعنى يُشير إلى وجود استجابة ميكانيكية ما Mechanical Response (أي إلى وجود خرج على شكل إزاحة Output Displacement).

يمكن تطبيق إشارات كهربائية على أطراف تحكم ثم تحويلها بمحولات تحكم إلى قوى متغيرة لتعمل خصائص العنصر الميكانيكي بأسلوب مضبوط ومفيد.

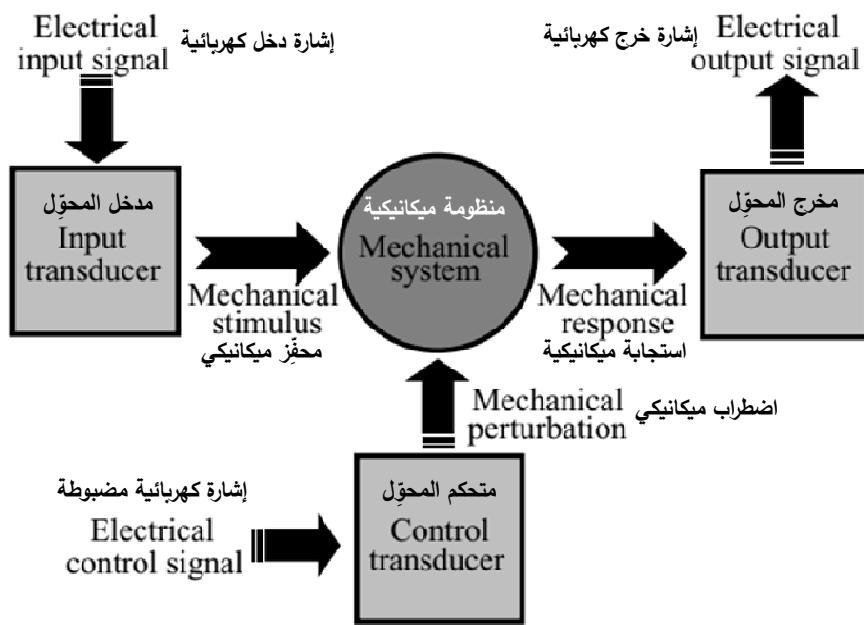
يوضح **الشكل (44-5)** المخطط العام لـ NEMS حيث تمثلت محولات/أطراف الدخل، والخرج، والتحكم تخطيطياً:

► **العنصر الميكانيكي الأساسي** لـ **NEMS** هو فلم معلق نانوي بعد، **غشاء أو عارضة** (Beam) (سنستعمل في المناقشة الآتية مصطلح "عارضه").

► **تضمن** تشوهات الثنوي **Flexural Deformations** السهلة لمثل هذه العناصر الميكانيكية **استجابة** ميكانيكية عالية من أجل NEMS.

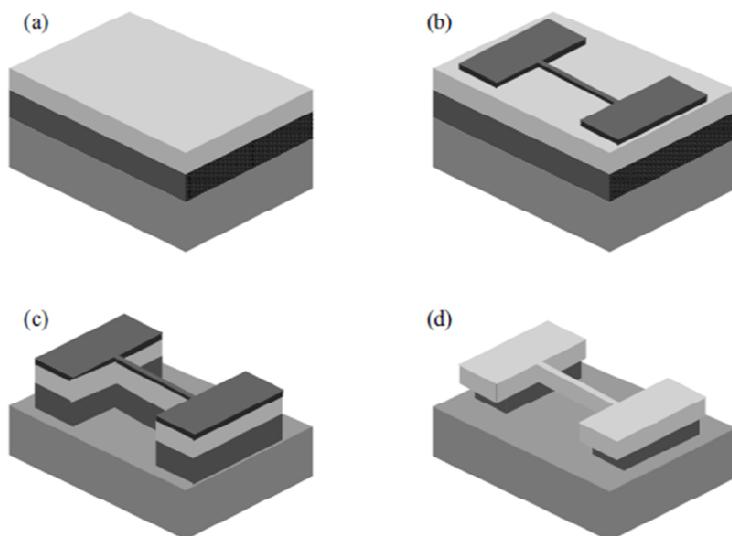
► ويفترض أن تكون النبائط الإلكترونية التي تقرن بها العارضة بأبعد قربة منها. لندرس الآن تصنيع المكون الميكانيكي الأساسي لـ NEMS؟

- **يُستخدم النمو البلوري** ونمو التركيب المتغيرة وتقنيات المعالجة، التي قمنا بدراستها سابقاً، على نطاق واسع، **في الحصول** على تراكيب نصف ناقلة معلقة.
- ويجد بالذكر أنه يمكن تطبيق هذه التقنيات على السيلكون الحجمي، والسيلكون الفوقي، والجمل التي قوامها المركبات III-V، ومواد أخرى.



يوضح **الشكل (45-5) الإجراء Procedure** المتبوع في تصنيع بنية معلقة نانومترية:

- يبدأ هذا الإجراء بأسط شكل له من تركيب متغير Heterostructure يحوي
 - ✓ طبقة بنوية (باللون الرمادي الفاتح) (Gray)

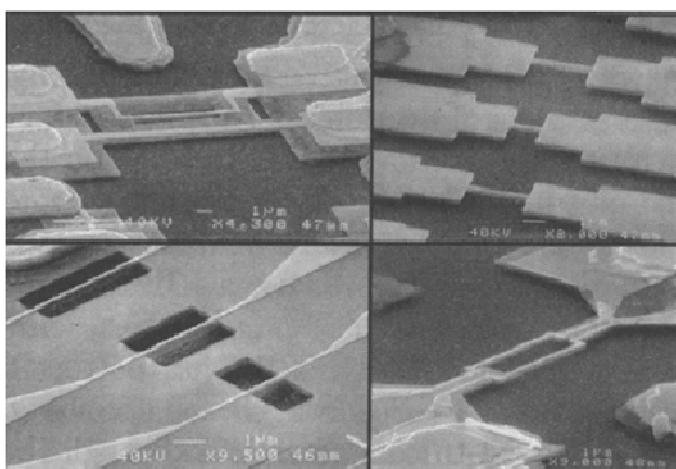


الشكل (45-5): رسم تخطيطي لصناعة تركيب NEMS معلقة باستعمال طبقات بنوية (الرمادي) و"ضحية" (الغامق) على ركيزة (الرمادي الغامق): (a) تركيب متغير كأساس مكون من ثلاثة طبقات؛ (b) ترسيب قناع بالتميّش والإذابة؛ (c) إذابة غير متماثلة المنحني؛ (d) إذابة رطبة انتقائية لطبقة "الضحية".

- ✓ وطبقة ذَوَابَة (طبقة "ضحية" Sacrificial Layer) متربستان الواحدة فوق الأخرى على ركيزة (باللون الرمادي الغامق Dark Gray)، كما يظهر في **الشكل (45a-5)**.
- يمكن تنميّط أقْنَعَة أعلى هذا التركيب المتغير باستعمال الطباعة الحجرية الضوئية والطباعة الحجرية بالحرمة الإلكترونية معاً يلي ذلك عمليات ترسيب فلم رقيق.
- يحمي القناع الناتج المادة الواقعه تحته تماماً في أشاء المرحلة اللاحقة، كما يظهر في **الشكل (45b-5)**.
- وعندَها تُزال المادة غير المحمية حول القناع بتطبيق عملية الحفر البلازمي، كما يبدو في **الشكل (45c-5)**.
- وأخِيرًا، تُزيل مرحلة التميّش الانتقائي الموضعي - كيميائياً - **الطبقة الذَوَابَة** - "الضحية" من المناطق المخصصة لخلق تركيب نانوي معلق معزول حرارياً وميكانيكيًّا، كما يظهر في **الشكل (45d-5)**.
- يمكن تكرار هذا الإجراء بضعة مرات وضمه إلى عمليات الترسيب المختلفة لإنتاج التركيب النانوي الميكانيكي اللازم لنبيطة معينة.
- إن مرونة هذه العملية تسمح بتطبيق هذا المخطط العام على مختلف المواد وبتصنّيع تركيب معلقة تماماً بأبعاد جانبية تبلغ بضعة عشرات النانومترات تقريباً.
- لدرس، على سبيل المثال، **الحالة المهمة للموائمة النانوية السيليكونية** باستعمال ما يسمى عملية - **SIMOX** (عملية الفصل بغرس الأكسجين Separation by IMplantation of OXYgen).

- يبدأ الإجراء من رقاقة- **Si** تُعالج بجرعة كبيرة من أيونات الأكسجين أي أنها تُغرس في الرقاقة السليكونية.
- ثم تُلَدَّن الرقاقة المزروعة في درجة حرارة عالية لتشكل طبقة كوارتز- **SiO₂** بسماكة $(0.05-1)\mu\text{m}$.
- بعد ذلك، تُنَمَّى فوق طبقة **SiO₂** المتَشكَّلة بلورة سليكونية **Si** وحيدة التبلور. إِذ تبلغ سماكة هذه الطبقة الفوقيَّة $(0.1-0.2)\mu\text{m}$.
- وبنتيجة ذلك، يتم الحصول على **تركيب متغِير (Si_xSiO₂_{1-x})** يُوافق التركيب (طبقة رمادية/طبقة عاتمة/طبقة رمادية غامقة) الظاهر في **الشكل (45-5)** الذي يشمل كل مراحل تحضير التركيب المتغِير:
 - إِذ تم تتميَّط طبقة **Si** العلوية وإِزالة القناع في **الشكل (45b-5)**.
 - ثُم طُبِّقت عملية التتميَّش الأنزوتروبي على طبقة **Si** العلوية، كما يُظَهَّر في **الشكل (45c-5)**.
 - وفي النهاية، خضع الأكسيد إلى تتميَّش رطبٍ انتقائيٍ لخلق بنية معلقة، كما يُبَدَّو في **الشكل (45d-5)**.
- إن عملية SIMOX التي يمكن تطبيقها على رقائق بمساحات كبيرة (بأقطار تبلغ من 4 بوصات إلى 6 بوصات) تُسْهِل استكمال Integration (بمعنى تكوين هنا) عدد من NEMSS والنبائط الإلكترونية الأخرى على **رقاقة Chip**.
- ويوضح **الشكل (46-5)** بعض التراكيب المعلقة المصنَّعة بهذه الطريقة.

في الختام، لا بد من الإشارة إلى إمكانية تصنيع منظومات كهروميكانيكية جديدة بفضل التكنولوجيات المتقدمة حيث تمتلك هذه المنظومات أبعاد صغيرة إلى درجة تكون عندها حركتها الميكانيكية (اهتزازاتها



الشكل (46-5): أربع منظومات NEMS مختلفة تم تصنيعها بطريقة SIMOX.

Vibrations المرتبطة بالإلكترونات أشد بكثير منها في الحالة الحجمية - في العينات الحجمية. يمكن بناء عدد من النباتات النانوية على أساس NEMSS.



مكتبة
A to Z